

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【公開番号】特開2011-233597(P2011-233597A)

【公開日】平成23年11月17日(2011.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2011-046

【出願番号】特願2010-100298(P2010-100298)

【国際特許分類】

H 01 L 21/20 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/20

【手続補正書】

【提出日】平成25年3月28日(2013.3.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

そして、図4に示すように、ガラス基板20を図中右方へ移動させる。そうすると、ガラス基板20の位置が、ピッチPの3倍の距離だけ移動した時点で、マイクロレンズ5及びマスク3の下方にマイクロレンズ5の3列分の幅だけ入り込む。そして、この時点で、レーザ光30を1ショット照射する。そうすると、アモルファスシリコン膜22においては、ピッチPの3列分のマイクロレンズ5により集光された領域10がレーザ光により加熱されて昇温し、溶融凝固して、この領域10が結晶化する。これにより、この3列分の領域10がポリシリコン膜となる。3列分のマイクロレンズ5以外のマイクロレンズ5には、遮光板7により遮光されてレーザ光は照射されない。